

# КОМПЛЕКТ УСТАНОВОК ПОЛУЧЕНИЯ ВЫСОКОЧИСТЫХ ГИДРИДНЫХ МАТЕРИАЛОВ МЕТОДОМ РЕКТИФИКАЦИИ

## ГИДРИД

**Назначение:** Получение высокочистых гидридных материалов с чистотой 99,99994 методом периодической высокотемпературной ректификации.



### Особенности:

- Гидридные материалы для очистки:  
Салют 5 – фосфин ( $\text{Ph}_3$ );  
Салют 6 – моносилан ( $\text{SiH}_4$ );  
Салют 7 – моносилан ( $\text{SiH}_4$ );  
Салют 8 – аммиак ( $\text{Nh}_3$ );
- Автоматизированное управление;
- Химически стойкая вакуумная система откачки;
- Габариты технологических шахт для каждой колонны (ДхШхВ) – 1,5х1,0х6,8 м;
- Мощность потребления не более 20 кВт.

